

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКОПЛЁНОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ СЕРЬБРО-СЕЛЕН-АЛЮМИНИЙ

С.И.Конев, Х.И.Кляус

Осциллограмма вольтамперной характеристики тонкоплёночного переключающего элемента со структурой $Ag-Se-Al$ приведена на рис.1. Некоторые экспериментальные данные этого элемента описаны в работах [1, 2]. Структура $Ag-Se-Al$ изготавливается методом вакуумного осаждения исходных материалов на изолирующую подложку. Толщины плёнок были следующие: $Ag = 2000 \text{ \AA}$, $Se = 6000 \text{ \AA}$, $Al = 2500\text{\AA}$. Площадь электродов изменилась от 10^{-4} до 10^{-1} см^2 .

Вольт-амперная характеристика элемента в координатах \sqrt{I} и U приведена на рис. 2. На этом рисунке ясно виден порог, вызванный контактной разностью потенциалов металлических электродов $U_{\text{отс.}} = 0,5 \text{ в}$. Ширина слоя пространственного заряда, определенная по емкости при нулевом смещении C_0 и относенная ко всей площади электродов, составляет $W = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ см}$. Максимальная напряженность поля от контактной разности потенциалов в диэлектрике при отсутствии внешнего напряжения $E_0 = 3 \cdot 10^4 \text{ в/см}$.

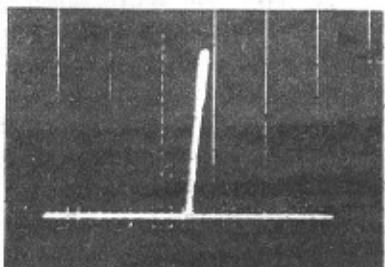


Рис. 1. Осциллограмма вольтамперной характеристики тонкоплёночного переключающего элемента. Частота переключения 100 Гц, цена деления по оси $= 0,1 \text{ в/дел.}$, по оси $= 2 \cdot 10^{-5} \text{ а/дел.}$

нулевом смещении C_0 и относенная ко всей площади электродов, составляет $W = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ см}$. Максимальная напряженность поля от контактной разности потенциалов в диэлектрике при отсутствии внешнего напряжения $E_0 = 3 \cdot 10^4 \text{ в/см}$.

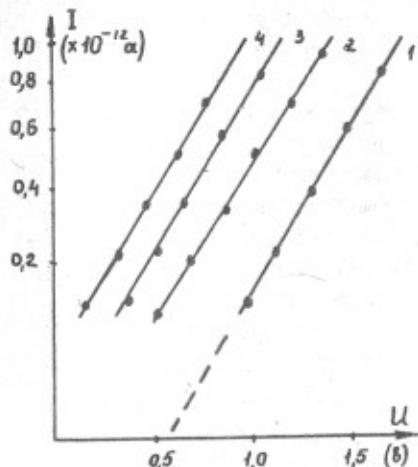


Рис. 2. Вольтамперная характеристика тонкоплёночного переключающего элемента в координатах \sqrt{I} и U . 1 - 20°C , 2 - 40°C , 3 - 60°C , 4 - 80°C .

Переключение элемента из состояния низкой проводимости в состояние высокой проводимости происходит на квадратичном участке вольтамперной характеристики. Ток, протекающий через элемент в состоянии высокой проводимости, при изменении температуры образца от 173°K до 400°K практически не изменяется. Изменение величины тока до включения I_0 от температуры иллюстрируется на рис. 2. Эта область вольтамперной характеристики исследовалась при токах меньших чем ток включения элемента $I_{\text{вкл}} = 10^{-10} \text{ а}$.

Вольтамперная характеристика исследовалась на постоянном токе (плюс источника напряжения на серебряном электроде).

Кривая зависимости обратного тока элемента от освещенности приведена на рис.3. При интенсивности освещения $F = 1,5 \cdot 10^4 \text{ лк}$ обратный ток $\sim 10^{-6} \text{ а}$ и при дальнейшем увеличении интенсивности светового потока величина тока остается практически постоянной.

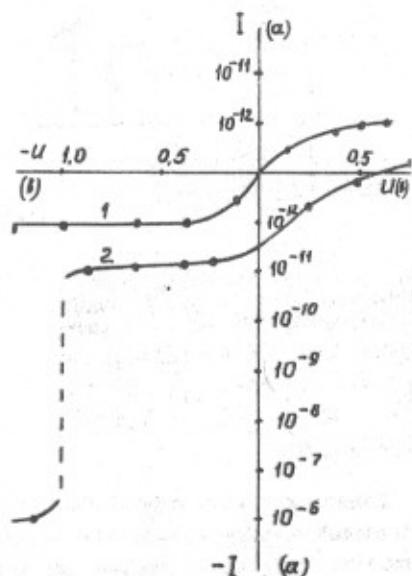


Рис.3. Вольтамперная характеристика элемента: 1 - в темноте, 2 - при освещенности $1,5 \cdot 10^4 \text{ лк}$.

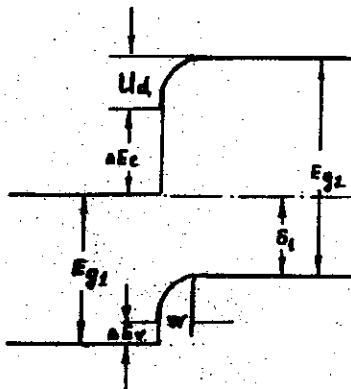
На основании измерения проводимостей структуры $\text{Ag}-\text{Se}-\text{Al}$ в состоянии низкой и высокой проводимости определены концентрации носителей в прикатодной области $n=10^5 \text{ см}^{-3}$ и $n=10^{15} \text{ см}^{-3}$ соответственно.

Отсутствие заметной температурной зависимости от тока после включения говорит о металлическом характере проводимости, что можно объяснить обогащением зонами серебра прикатодной области ($\text{Se}-\text{Al}$) под воздействием внешнего напряжения в результате чего наступает вырождение селена. После снятия внешнего напряжения под воздействием контактной разности потенциалов $U_{\text{отс.}}$ происходит обеднение этой области, что приводит к переключению элемента в состояние низкой проводимости. Следует отметить, что в селениде серебра [2] находится избыточная концентрация атомов серебра и он близок к вырождению. Поэтому вся контактная разность потенциалов практически приложена к обедненной области (к селену).

Представление о существовании двух областей слабого (Se) и сильного ($\text{Ag}-\text{Se}$) легирования дает возможность предполагать существование гетероперехода (ГП) в структуре $\text{Ag}-\text{Se}-\text{Al}$. На основании этого возможно качественное построение энергетической зонной диаграммы (рис. 4) [3].

Рис. 4. Энергетическая зонная диаграмма ГП тонкопленочной структуры $\text{Ag}-\text{Se}-\text{Al}$ в разновесии при 300°K . $E_{g1}=1,5$ эв, $E_{g2}=2,2$ эв, $w=1,5 \cdot 10^{-5} \text{ см}$, $\delta=0,82$ эв, $\Delta E_c=0,9$ эв, $\Delta E_v=0,2$ эв.

Данные для построения этой диаграммы были получены из исследования параметров вольтамперных и вольтемпостных характеристик. Величина разрывов зон составляет $\Delta E_c=0,9$ эв, $\Delta E_v=0,2$ эв. При построении энергетической диаграммы использовались следующие данные $U_{\text{отс.}}=0,5$ в, $E_{g1}=1,5$ эв, $E_{g2}=2$ эв [4].



На основании сопоставления приведенных экспериментальных данных с теорией ТОПЗ для диэлектриков с ловушками найдено выражение для определения величины тока срыва

$$j = \frac{z m_n (ne)^2 d}{9 \epsilon \Theta}$$

где m_n - подвижность электронов в сelenе, n - концентрация электронов, e - их заряд, ϵ - диэлектрическая постоянная селена, $\Theta = \frac{N_c}{N_t} \exp\left(-\frac{E}{kT}\right)$ - степень заполнения ловушек, d - протяженность слаболегированной области.

Вычисленное значение тока срыва по приведенной формуле дает удовлетворительное совпадение с величиной полученной экспериментально.

Л и т е р а т у р а

1. КОНИЕВ С.И., МИШИН А.И. - В сб. "Вычислительные системы", вып. 26, Новосибирск, "Наука" СО, 1967.
2. ШАПОЧАНСКАЯ З.В., КОНИЕВ С.И., КЛЯУС Х.И. - ФТН, вып. 5, т. 4, 1970.
3. R.L. Anderson. *Sol. St. Electron.*, 5, 341, 1962.
4. ЧИЖИКОВ Д.М., СЧАСЛИВЫЙ В.П. Селен и селениды. "Наука", 1964.